(12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平7-12247

(43)公開日 平成7年(1995)1月17日

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

F 1 6 K 7/17 B 7214-3 H

21/16

51/00

審査請求 未請求 請求項の数16

(全6頁)

(21)出願番号

特願平6-108132

平成6年(1994)5月23日

(31)優先権主張番号

065705

(32)優先日

1993年5月24日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 591198353

OL

スローン ヴァルヴ カムパニー ふるかん アメリカ合衆国. イリノイズ, フランクリ

ン パーク, セイモア アヴェニュー 1...

0500

(72)発明者 ジョン エフ. ホワイトサイド

アメリカ合衆国. 60131 イリノイズ,フ ランクリン パーク メイブル ストリー

ト 2646

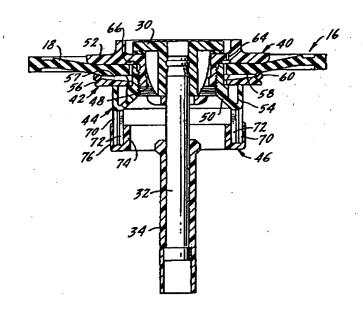
(74)代理人 弁理士 岡部 正夫 (外9名)

(54)【発明の名称】洗浄弁フィルタ及びバイパス・オリフィス

(57)【要約】

【目的】 ダイヤフラム式の洗浄弁に使用されるフィル タ及びパイパス・オリフィスの改良と製作の簡易化を図 る。

【構成】 小便器や水洗便器のようなトイレット装置と 共に使用されるダイヤフラム式の洗浄弁は、入口12及 び出口14を有する本体10と、入口12及び出口14 の間に位置する弁座26とを有する。弁部材は、弁座2 6上の閉成位置に移動可能であり、この閉成位置におい て入口12と出口14との間の流れを止める。弁部材 は、本体10に外周部で取付けられたダイヤフラム18 と、前記ダイヤフラム18に取付けられ出口14への水 流を制御する補充リング44と、補充リング44をダイ ヤフラム18に取付けるのに使用される保持ディスク4 0とを有する。ダイヤフラムの上方には圧力室68が設 けられ、この圧力室68は弁部材を弁座26上に保持す る。フィルタ56及びバイパス・オリフィス64は、入 口12と圧力室68とを接続し、このバイパス・オリフ ィス64は保持ディスク40に形成され、フィルタ56 の一部はダイヤフラム18の一部によって構成される。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】小便器及び水洗便器のようなトイレット装 置と共に使用されるダイヤフラム式洗浄弁において、

入口及び出口を有する本体と、前記入口と前記出口との 間に位置する弁座と、前記弁座上の閉成位置に移動可能 であり、この閉成位置において前記入口と前記出口との 間での流れを止める弁部材と、を有し、

前記弁部材は、前記本体に外周部で取付けられたダイヤ フラムと、前記ダイヤフラムに取付けられ前記出口への イヤフラムに取付ける保持ディスクとを有し、前記洗浄 弁は更に、

前記ダイヤフラムの上方に位置し、前記弁座上に前記弁 部材を保持する圧力室と、前記入口と前記圧力室とを接 続するフィルタ及びバイパス・オリフィスとを有し、 前記パイパス・オリフィスは前記保持ディスクに形成さ れ、前記フィルタの一部は前記ダイヤフラムの一部によ って構成されることを特徴とする洗浄弁。

【請求項2】前記ダイヤフラムに隣接配置され、前記ダ イヤフラムと協働して所定の大きさの複数個のフィルタ 20 通路を形成するフィルタディスクを更に有し、

前記複数個の通路は前記パイパス・オリフィスに連通し ていることを特徴とする請求項1に記載の洗浄弁。

【請求項3】前記所定の大きさの複数個のフィルタ通路 は前記ダイヤフラムのまわりに周方向に存在しているこ とを特徴とする請求項2に記載の洗浄弁。

【請求項4】前記フィルタディスクは前記ダイヤフラム の下方に位置し、前記補充リングと前記ダイヤフラムと の間に保持されていることを特徴とする請求項3に記載 の洗浄弁。

【請求項5】前記フィルタディスクは、前記ダイヤフラ ムに対向しかつそれに接した周方向表面を有し、前記フ ィルタディスク表面は互いに離間した複数の溝を有し、 前記溝は前記所定大きさのフィルタ通路を画成すること を特徴とする請求項4に記載の洗浄弁。

【請求項6】前記通路の入口において前記ダイヤフラム・ と前記フィルタディスクとの間に位置するシール・リン グを更に有することを特徴とする請求項4に記載の洗浄 弁。

【請求項7】前記補充リングに形成され前記フィルタ通 40 路と前記バイバス・オリフィスとを接続する通路手段を 更に有することを特徴とする請求項2に記載の洗浄弁。

【請求項8】前記保持ディスクに形成された環状溝を更 に有し、前記環状溝は前記補充リングに対向し、かつ前 記補充リング通路手段に連通すると共に前記バイパス・ オリフィスに連通することを特徴とする請求項7に記載 の洗浄弁。

【請求項9】ダイヤフラムと、前記ダイヤフラムに取付 けられ、洗浄弁入口と洗浄弁出口との間の水の流れを制 御する補充リングと、前記補充リングを前記ダイヤフラ 50

ムに取付ける保持ディスクとを有するトイレット装置の 洗浄弁に使用され、前記洗浄弁の弁座上で閉成される弁 部材アッセンブリであって、

フィルタ及びバイバス・オリフィスが前記弁部材アッセ ンプリに形成され、前記フィルタ及びバイパス・オリフ ィスは前記洗浄弁入口と前記弁部材アッセンブリの上方 に位置する洗浄弁圧力室とを接続して、前記弁部材アッ センブリを弁閉成位置へ移動させ、前記バイバス・オリ フィスは前記保持ディスクに形成され、前記フィルタの 水流を制御する補充リングと、前記補充リングを前記ダ 10 一部は前記ダイヤフラムの一部によって構成されること を特徴とする弁部材アッセンブリ。

> 【請求項10】前記フィルタディスクが前記ダイヤフラ ムに隣接配置され、前記フィルタディスクは前記ダイヤ フラムと協働して前記所定の大きさの複数のフィルタ通 路を画成し、前記通路は前記保持ディスクバイパス・オ リフィスに連通していることを特徴とする請求項9に記 載の弁部材アッセンブリ。

【請求項11】前記所定の大きさのフィルタ通路は前記 ダイヤフラムのまわりに周方向に存在していることを特 徴とする請求項10に記載の弁部材アッセンブリ。

【請求項12】前記フィルタディスクは前記ダイヤフラ ムの下方に位置し、前記補充リングと前記ダイヤフラム との間に保持されることを特徴とする請求項11に記載 の弁部材アッセンブリ。

【請求項13】前記フィルタディスクは、前記ダイヤフ ラムに対向しかつそれに接した周方向表面を有し、前記 フィルタディスク表面は互いに離間した複数個の溝を有 し、前記複数個の溝は前記所定の大きさのフィルタ通路 を画成することを特徴とする請求項12に記載の弁部材 アッセンブリ。

【請求項14】前記通路の入口において前記ダイヤフラ ムと前記フィルタディスクとの間に配置されたシール・ リングを更に有することを特徴とする請求項12に記載 の弁部材アッセンブリ。

【請求項15】前記補充リングに設けられ、前記フィル 夕通路と前記パイパス・オリフィスとを接続する通路手 段を更に有することを特徴とする請求項10に記載の弁 部材アッセンブリ。

【請求項16】前記保持ディスクに形成された環状溝を 更に有し、前記環状溝は前記補充リングに対向し、かつ 前記補充リング通路手段に連通すると共に前記バイバス ・オリフィスに連通することを特徴とする請求項15に 記載の洗浄弁アッセンブリ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

30

【産業上の利用分野】本発明は、小便器や水洗便器のよ うなトイレット装置と共に使用される種類の洗浄弁に関 し、特にダイヤフラム式の洗浄弁に関する。本発明は、 更に詳述すると、ダイヤフラム洗浄弁用のフィルタ及び バイパス・オリフィスに関する。

BEST AVAILABLE COPY

[0002]

【発明が解決しようとする問題点及び問題点を解決するための手段】公知のパイパス・オリフィスの大部分は、ダイヤフラム内に挿入される別部材で構成されているが、これは労働集約的な製造工程である。そこで、本発明によるパイパス・オリフィスはダイヤフラム保持ディスク内に一体形成され、これによってセパレート部材としての部品を除去でき、製造及び組立ての際にかなりのコストダウンを達成することができる。フィルタは、パイパス・オリフィスの上流側に位置するので、このパイパス・オリフィスの詰りを生じさせる恐れのある微粒子を除去することができる。このようなフィルタは、ダイヤフラムの周囲ほぼ360°にわたって分布したかなりの数のフィルタ通路を有し、全体としてはかなりの流量を通すことができるが、各通路はパイパス・オリフィスの保護の為に小面積に定められている。

【0003】本発明は、ダイヤフラム式の洗浄弁に使用されるフィルタ及びバイバス・オリフィスの改良に関する。本発明の基本的な目的は、製造コストをかなり低減することができるバイバス・オリフィス及びフィルタの20改良を提供することである。本発明の別の目的は、公知のバイバス・オリフィスのような別体部分から成るのではなく、洗浄弁内においてダイヤフラムを保持するいくつかの部品のうちの一部品内に成形されたバイバス・オリフィスを提供することである。別の目的に係わる上述したようなダイヤフラム式洗浄弁に使用されるフィルタは、大きな流路面積を有するが、この流路面積は、水中の不純物からバイバス・オリフィスを保護する為に、多数の小開口から構成される。その他の目的は、以下の説明や図面や特許請求の範囲から明らかになるであろう。30【0004】

【実施例】図は、本願の出願人であるイリノイ州フランクリンパークのスローン ヴァルヴ社が製造し「ROYAL」の商標で販売する種類の洗浄弁を示したもので、この洗浄弁は本体10を具備し、この本体10は入口接続部12と出口接続部14とを有する。ダイヤフラム・アッセンブリは全体が16で示され、ダイヤフラム18を有し、このダイヤフラム18はその周辺部が内側カバー20によって本体10に保持されている。詳述すると、ダイヤフラム18は本体10の上端の肩部22上に 40 戦置され、内側カバー20によってこの位置に締めつけられている。外側カバー24は本体10にネジ螺合されて、内側カバー20を所定位置に保持している。

【0005】ダイヤフラム・アッセンブリ16は図1に示したように、バレル28の上端に形成された弁座26の上で閉成される。このバレル28は、弁座26を出口14に接続する導管を構成している。ダイヤフラム・アッセンブリ16は逃がし弁30を具備し、この逃がし弁30は可動スリーブ34を担持する下方に延在するステム32を有する。このスリーブ34は、ハンドル38の50

操作時に図示の種類の洗浄弁の動作として公知の方法 で、プランジャ36によって接触されるように配置され ている。

【0006】ダイヤフラム・アッセンブリ16について 詳述すると、このダイヤフラム・アッセンブリ16は、 図2に示したようにダイヤフラム18及び逃がし弁30 のほかに、保持ディスク40と、フィルタディスク42 と、補充 (refill) リング44と、流量制御リン グ46とを具備する。この保持ディスク40は内側の円 筒状ネジ部48を有し、この円筒状ネジ部48は補充リ ング44の円筒状ネジ係合部50に螺合取付される。こ のようなネジ結合によって、ダイヤフラム18は保持デ ィスク40の上部52とフィルタディスク42との間に 締着される。補充リング44は上方に延在する円筒部5 4を有し、この上方延在の円筒部54はフィルタディス ク42の底部に当接し、これによって、補充リング44 と保持ディスク40との組合がダイヤフラム18及びフ ィルタディスク42を一緒に締着し、こうしてダイヤフ ラム・アッセンブリ16が構成される。

【0007】フィルタディスク42の上面には、狭い間 隔で円周方向に配列された小溝56が設けられ、例え ば、これらの溝56は0.012インチの深さを有して いる。このような溝56を有するフィルタディスク42 の上面は、ダイヤフラム18の下面58に対向し、これ によりダイヤフラム18の下面58は溝56によって構 成された通路の上部境界を形成している。これらの溝5 6は、フィルタ通路として働き、水中の微粒子がフィル 夕を通過することを阻止する大きさに定められ、これに よって後述のバイパス・オリフィスの詰りを防止するこ とができる。溝56の入口には、環状のシール・リング 60が配置され、この環状のシール・リング60は、ダ イヤフラム18の下面58とフィルタディスク42の外 方傾斜面59(図10及び図11参照)との間に保持さ れている。これらのシール・リング60とダイヤフラム 18と通路56との組合せが、バイパス・オリフィスの 上流側に位置するフィルタを構成し、このフィルタの大 きさは、水中の微粒子によるバイパス・オリフィスの詰 りを防止するように定められている。詳述すると、円周 方向配置の溝56は、実質的に水流の流路を形成する が、その開口の大きさは、水中の不純物がバイバス・オ リフィスを詰まらせることを防止するように選定されて いる。こうして、フィルタ溝56は、バイパス・オリフ ィスがその所期の機能を果たすように、パイパス・オリ フィスを保護している。

【0008】溝56を通ってフィルタディスク42の内部に流入した水は、補充リング44とダイヤフラム18の内部との間の空間に達し、補充リング44の円筒部50の外面に形成された2個の平坦化領域62(図4及び図6参照)に流入する。なお、平坦化領域62は、本実施例では2個であるが、本発明では3個以上であっても

良い。これらの平坦化領域62は、フィルタ通路56と 半径方向溝57とを保持ディスク40のパイパス・オリ フィス64に接続する水路を構成している。このパイパ ス・オリフィス64は、保持ディスク40の環状溝66 に連通し、環状溝66は補充リング44に対向し、この 補充リング44の平坦化領域62に連通している。こう して、水は、個々の溝56によって構成されるフィルタ から補充リング44の突起部50の平坦化領域62に流 れ、その後、保持ディスク40の底面の環状溝66に流 入する。この溝66はパイパス・オリフィス64に接続 10 されているので、水はこれらの通路を通って、内側カパ ー20とダイヤフラム・アッセンブリ16との間に位置 する圧力室68に流入する。

【0009】この技術分野ではよく知られているように、本明細書に開示した種類の洗浄弁は、ダイヤフラム18を座26上で閉成状態に保つためには、室68内が加圧されている必要がある。この為に、入口12の水は、上述のフィルタ及びバイバス64を通って室68に流入して、ダイヤフラム18を図示の閉成状態に保つ。補充リング44は外側に面した鉛直溝70を複数有し、これらの鉛直溝70の一部は通路72を有し、これらの通路72は溝70を補充リング44の内側に接続している。溝70を通って通路72に至る通路が、洗浄弁動作の際に水が出口に達する為の唯一の通路である。なお、通路72の個数及び寸法は洗浄動作時に流れる水量を決定する。

【0010】小便器や水洗便器のようなトイレット装置 の動作時に使用される水量を厳格に規制する行政規定が ある場合があり、かつ各トイレット装置毎に規制条件が 異なる場合がある。本明細書に示した弁は小便器と水洗 30 便器との両方に使用され、かつ水規制の内容が種々異な った地区で使用されることもあるので、補充リング通路 72の寸法は、この弁を使用する地域で規定された特別 な条件を充足するように、選定される。この為に、流量 制御リング46は上方に延在する環状突起74を有し、 この環状突起74は補充リング44の内面に沿って延在 して、水流が通過できる通路72の領域範囲を決定して いる。なお、通路72は補充リング44の全長に沿って 延在してもよいが、しかし通路72のうちのどの部分を 水が流通させるかは、流量制御リング46、特にその部 40 分74の高さによって決定される。従って、流量制御リ ング46の寸法を変更することによって、洗浄時に流れ る水量を変えることができる。

【0011】補充リング44の外面は、バレル28の内面にぴったりと嵌合する寸法に定められている。補充リング44は、後述のように洗浄弁の動作時にダイヤフラム・アッセンブリ16と共に上昇するが、この時にも、流量制御リング46の外部突起76とバレル28の内面とは常に円周方向で接触し、これにより水はすべて通路72を通過することになる。

【0012】次にこの作用を説明する。ハンドル38を 旋回すると、プランジャ36が逃がし弁30のスリーブ 34に接触する。これによって逃がし弁30が傾斜する と、室68の圧力がダイヤフラム18の内部を通って下 方に逃げる。これにより、ダイヤフラム18はその座か ら上昇して、ダイヤフラム・アッセンブリ16を上方向 に引っ張り、入口12を補充リング44の通路72を介 して出口14に接続する。弁が動作されると直ちに、バ イバス・オリフィス64は、室68の再充填を開始す る。この再充填によって室68が充分に加圧されると、 ダイヤフラム・アッセンブリ16はその座26上の閉成 位置の方に移動する。ダイヤフラムは、この閉成位置へ の移動に伴い、入口12と出口14との間での水の流れ を絞り込み、ついにはそれを遮断する。特に図8に示し たように、補充リング44の外面は僅かに内方に傾斜し た表面80を有し、この表面80によって、補充リング 44は、バレル28内への移動による閉成時に弁内の背 圧を制御することができる。これを詳述すると、背圧 は、弁の閉成速度を制御して、弁を比較的迅速に閉成す ることができる。洗浄時に弁を通過する水のガロン数 は、補充オリフィスを通る流量と、補充リング44がバ レル28内に移動する時の弁の閉成速度とによって、或 る程度決定される。一回の洗浄動作の間に弁を流れる流 量は、入口12の水圧に無関係となることが望ましい。 これは、背圧を制御することによって達成され、この背 圧は補充リング44の外面の傾斜表面80とバレル28 の軸方向表面とのなす角度である流量制御角によって決 定される。本明細書では本発明の好適な実施例を図示し 説明したが、本発明には種々の変更例や置換例や代替例 が存在するであろう。

6

【図面の簡単な説明】

【図1】洗浄弁を一部断面で示した側面図。

【図2】ダイヤフラム・アッセンブリを示した拡大断面 図。

【図3】補充リングを示した側面図。

【図4】補充リングを示した平面図。

【図5】補充リングを示した底面図。

【図6】図4の平面6-6に沿った断面図。

【図7】水通路を示した補充リングの拡大部分断面図。

0 【図8】補充リングの外壁を示した拡大部分断面図。

【図9】フィルタディスクの平面図。

【図10】図9の平面10-10に沿った断面図。

【図11】図9の平面11-11に沿った拡大断面図。

【図12】保持ディスクの平面図。

【図13】図12の平面13-13に沿った断面図。 【符号の説明】

10 洗浄弁本体

12 入口

14 出口

50 16 ダイヤフラム・アッセンブリ

7

18 ダイヤフラム

26 弁座

40 保持ディスク

42 フィルタディスク

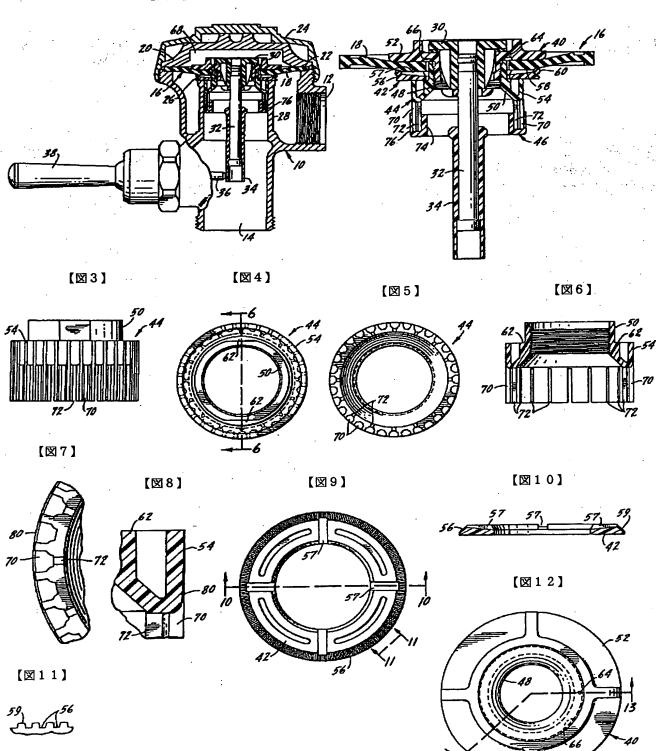
4.4 補充リング

64 バイパス・オリフィス

68 圧力室

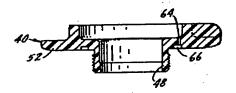
【図1】

【図2】



DESI AVAILABLE COPY

[図13]



BEST AVAILABLE COPY